

加工

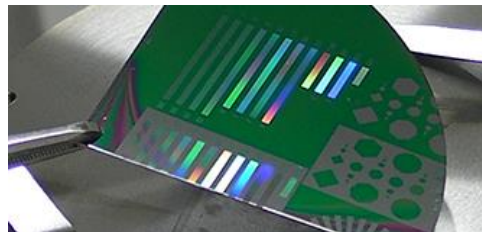
(エッチング装置群)

イオンシャワー

ELIONIX社製 EIS-200ER

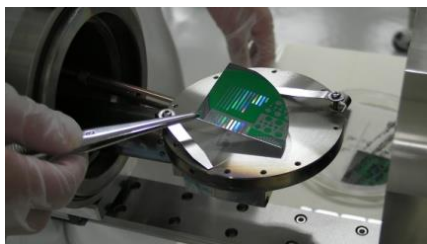
仕様

イオン銃	電子サイクロロン共鳴(ECR)型
イオン化ガス	Ar, Xe, 等, 不活性イオン種用ガス N ₂ , O ₂ , 等, 活性イオン種用ガス
加速電圧	30V~3000V連続可変
イオン流密度	Ar: 1mA/cm ² 以上(2kV加速時)
イオンビーム有効径	φ 20mm
動作真空度	5.0 × 10 ⁻⁵ ~ 3.0 × 10 ⁻⁴ Torr
試料寸法	φ 4インチMAX(回転機構付き)
電氣的シャッター	加速電圧のON OFF機構



超微細加工

気体をイオン化し、そのイオンを加速させエネルギーを与え固体表面をエッチングする装置です。低加速電圧でも高い電流密度が得られるため、基板へのダメージの少ないエッチング、表面クリーニングなどが可能です。半導体ウエハのパターンエッチングなどに利用可能であり中和電極採用のため絶縁物へのエッチングも可能です。EB描画装置で描画したマスクに直接エッチングを行うことで、微細なパターンを得ることができます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp